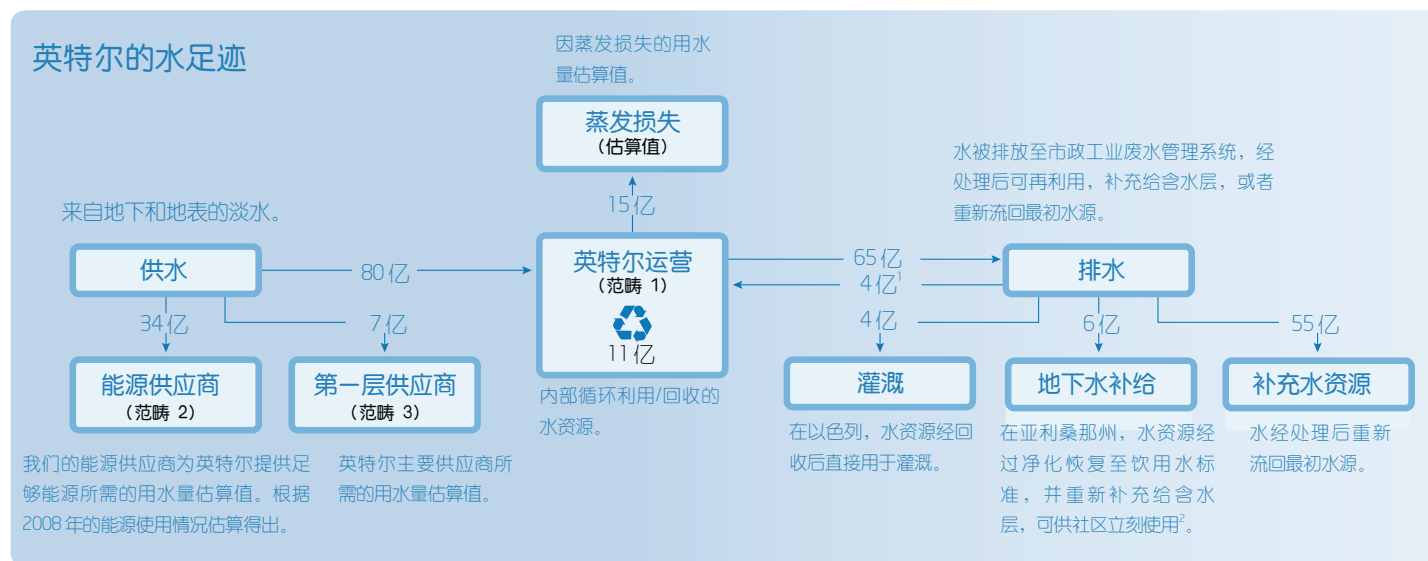


我们的最终目标是在半导体制造过程中实现水的持续再利用，目前我们会按照当地法规排出运营过程中生成的水。排水方法会因各个工厂周围社区的需求不同而有所差异，我们会配合当地水管理部门确定适合的排水解决方案。

水足迹分析

目前关于如何计算水足迹尚没有普遍认可的操作方法，不过，我们在 2009 年根据一系列新兴框架和研究成果进行了水足迹评估。与分析碳排放量的方法相似，我们对水资源使用分类为：范畴 1（用于直接运营）、范畴 2（与我们的能源使用相关）、范畴 3（由供应链使用）。英特尔正在参考这一水足迹分析来评估英特尔中国运行的水足迹分析。



1. 从亚利桑那州钱德勒市和加利福尼亚州圣克拉拉市的市政水处理厂回收，并供英特尔当地工厂使用的水资源。
2. 英特尔与钱德勒市政府合作，共同投资构建了一个反渗透工厂，该工厂自 1996 年起已将超过 40 亿加仑的水资源导回至含水层。这项策略有助于钱德勒地下水资源保护，以确保当地居民和企业在未来的用水需要。
3. 版权所有 © 2010 年 IEEE 组织。未经许可，不得转载。摘自《针对半导体行业执行水足迹评估》(Performing a Water Footprint Assessment for a Semiconductor Industry)。
4. 基于我们预计的水资源使用范畴 1、2 和 3。与“每块芯片”相关的条件是假定一般芯片的面积为 1 cm²，但实际尺寸会因产品之间的具体差异而有所不同。
5. 资料来源：水足迹网络组织 (Water Footprint Network)。